

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 2 区分

【発行日】平成25年10月10日 (2013.10.10)

【公表番号】特表2013-505136(P2013-505136A)

【公表日】平成25年2月14日 (2013.2.14)

【年通号数】公開・登録公報2013-008

【出願番号】特願2012-529790(P2012-529790)

【国際特許分類】

B 2 3 K 26/06 (2006.01)

B 2 3 K 26/36 (2006.01)

G 0 3 F 7/20 (2006.01)

G 0 3 F 1/76 (2012.01)

【F I】

B 2 3 K 26/06 J

B 2 3 K 26/36

G 0 3 F 7/20 5 0 5

G 0 3 F 1/76

【手続補正書】

【提出日】平成25年8月26日 (2013.8.26)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基材上へのレーザー像形成の用途のための、分散されたパターンを有するマスクであって、

光を透過させるための複数の開口と、前記開口の周囲の複数の非透過区域と、を有するマスクを備え、

前記複数の開口は、完成パターンにおける分散された部分を共同で形成し、

前記マスク中の前記開口が前記基材上に繰り返し像形成される場合に、前記分散された部分内の構造体は、像形成されたパターンの異なる領域内で合併し、分散されたステッチ線を使用して前記基材上に前記完成パターンを生成する、マスク。

【請求項 2】

繰り返す 2 つ以上の、特徴形状のアレイを備え、

前記特徴形状のアレイの各々は、完成パターンの一部として、構成要素パターンを形成し、前記特徴形状のアレイは、完成パターンを生成するために組み合わせられ、

前記特徴形状のアレイは、前記完成パターンの分散された部分を共同で形成し、且つ、複数の構造体を有し、

前記構造体は、分散されたステッチ線を使用して前記完成パターンを生成するために、像形成されたパターンの異なる領域内で繰り返し合併する、微細に複製された物品。